

「マルチスケール超臨界媒体の半導体プロセス応用」**Semiconductor processes using multi-scale supercritical media****山梨大工 [○]近藤 英一****University of Yamanashi, [○]Eiichi Kondoh****E-mail: kondoh@yamanashi.ac.jp**

超臨界流体は、昇温・昇圧下で物質が気体とも液体ともつかなくなった状態で、ナノ浸透性、低粘性、高熱伝導度、ゼロ表面張力、高誘電率、溶媒能などのユニークな性質を有している。超臨界 CO₂ は LSI ウェハ洗浄から MEMS、薄膜堆積、エッチング、ナノ構造作成まで多くの分野で活用が広がっており、超微細・立体構造の自律的な形成も可能である。

本講演では超臨界流体の特徴を、液体や気体と対比させて示す。